LOQ4232

LOQ4232 - Processos da Indústria Eletro Eletrônica

Processes of Electro Electronic Industry

Créditos-aula: 2

Créditos-trabalho: 0

Carga horária: 30 h

Departamento: Engenharia Química

Objetivos

Introduzir as técnicas de fabricação de dispositivos e circuitos integrados em microeletrônica. Apresenta os princípios, técnicas, equipamentos e softwares

utilizados na simulação e fabricação de dispositivos em silício e arseneto de gálio de uma maneira global e genérica.

Docente(s) Responsável(eis)

5840535 - Messias Borges Silva

Programa resumido

Processos de fabricação típicos e de montagem de sistemas eletroeletronicos

Programa

Técnicas de obtenção de silício cristalino e arseneto de gálio. Processamento de lâminas de silício e GaAs. Rede e Defeitos cristalinos. Oxidação. Dopagem

(difusão e implantação iônica). Litografia: (Fabricação de Fotomáscaras; Gerador de Padrões). Epitaxia. Deposição em Fase Vapor (CVD. PECVD e

LPCVD). Decapagem (úmida e seca). Equipamentos e técnicas de metalização (Evaporação térmica, feixe iônico, bombardeamento catódico (sputtering),

Caracterização de etapas de processo de fabricação. Simulação de processos de fabricação. Montagem de Sistemas Eletro Eletrônicos

Avaliação

Método: Aulas expositivas auxiliadas por transparências e métodos multimídia (datashow + computador) São previstas três aulas práticas com visitas

em ambientes de fabricação de circuitos integrados (salas limpas) e montagem de produtos eletroeletrônicos. Duas prvas e relatórios de trabalhos

práticos e visitas.

Critério: Média geral MG = [0,6 x (média aritmética das 2 provas feitas) + 0,2 x média dos trabalhos práticos + 0,2 x (média aritmética dos relatórios

de visitas)] >= 5,0. Os testes serão dados nos 10 minutos finais de N aulas escolhidas aleatoriamente. A prova substitutiva substitui a prova em que o

aluno faltou.

Norma de recuperação: 1 (uma) prova de recuperação.

Bibliografia

01 Stephen A. Campbell, The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication, 2nd edition, Oxford University Press, 2001;02 S.M. Sze - VLSI

Technology, McGraw-Hill, 1988;03 V. Baranauskas, org., Processos em Microeletrônica, SBV e SBMicro, 1990;04 R. A. Levy, Microelectronic Materials

and Processes, Kluwer Academic Publ., 1989;[05] M. Madou, Fundamentals of Microfabrication, CRC press, 1997.

Requisitos

LOQ4205: Sistemas Produtivos II (Requisito fraco)

Ver no Jupiter Salvar em pdf Salvar em docx

© 2020 . Contact: luizeleno@usp.br. Powered by Jekyll and Github pages. Original theme under Creative Commons Attribution